



報道発表

マイクロン社が EBEAM INITIATIVE に加盟

2020年2月25日、アメリカ合衆国 カリフォルニア州 サンノゼ市発 ― 電子ビーム (eBeam) 技術による新しい半導体製造技術の啓蒙と促進を専門的に取り上げる公開の業界団体であるイービーム イニシャチブ (eBeam Initiative) は本日、マイクロン社がイービーム イニシャチブに加盟したと発表しました。メモリと記憶装置での課題の解決法を提供する業界のリーダーとして、マイクロン社は半導体フォトマスク並びにリソグラフィのサプライチェーンにおけるイービーム イニシャチブの教育活動にユニークで重要な見解をもたらしてくれるでしょう。

イービーム イニシャチブは2009年、フォトマスク並びに半導体の設計と製造の業界のために、業界の声を代表した教育の基盤となるものを提供する事を目的に設立されました。その活動の一環として、イービームイニシャチブは新しい電子ビーム技術の導入の為の関連業界の活動を支援し、技術動向予測調査とマスクメーカー実績調査を毎年実施しています。マイクロン社-同社は2019年度のマスクメーカー実績調査に参加しました-を今回、50社以上の会員メンバーの新たな一員として迎え、イービームイニシャチブは今後とも電子ビーム技術のエコシステムの発展のための業界協調実現と言う使命を全うして参ります。

アメリカ合衆国、カリフォルニア州のサンノゼ会議センターで開かれている SPIE のアドヴァンストリソグラフィ学会の会期中の本日、イービーム イニシャチブは、今年のスポンサーである電子工業深層学習センター (Center for Deep Learning in Electronics Manufacturing [CDLe]) と共同で、第12回となる年次会合を開催します。マイクロン社マスク技術上級部長であるイゼキエル・ヴィダール-ラッセル博士が先端メモリ設計の為の、フォトマスク製造やリソグラフィの将来での成功のカギとなるインバース露光 (ILT) や曲線図形マスクを含むいくつかの話題を発表する予定です。発表資料は2月26日以降イービームイニシャチブのウェブサイト www.ebeam.org でご覧いただけます。

「電子ビーム技術は半導体産業の発展に常に役立ってきました-そしてマスク製造やリソグラフィにおける数多くの新しい挑戦に立ち向かわなければならない今日、より一層その重要度が高まってきています。我々の会員会社からの支持は、半導体産業が成功するか否かは新しい電子ビーム技術の開発の成否にかかっているという事を認識して頂く事に欠かせないものです。マイクロン社は既に我々の年次マスクメーカー実績調査において重要な貢献をして頂いて居ますが、同社を我々の新しいメンバーとしてお迎えする事が出来るのを大変嬉しく思います」とイービームイニシャチブの運営幹事会社である D2S 社の CEO、藤村晶が述べて居ます。

イービームイニシャチブ (The eBeam Initiative) に付いて:

イービームイニシャチブは電子ビーム技術に基づく新しい半導体製造方法の探求の為の啓蒙、促進活動を支援する公開討論の場です。その目指すものは、半導体のエコシステム全体を通じて電子ビーム技術への投資が増え続け、より多くの集積回路 (IC) 設計に着手することを可能とし、またより迅速な商品化を可能とする手段の選択をする時の障害を低減することです。

会員は半導体エコシステム各方面から構成され、次にあげる各社、各機関よりなります。
aBeam Technologies; アドバンテスタ(Advantest); Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; Aselta Nanographics; ASML; Cadence Design Systems; キヤノン(Canon); CEA-Leti; D2S; 大日本印刷(Dai Nippon Printing); EQUIcon Software GmbH Jena; eSilicon Corporation; Fraunhofer CNT; 富士通セミコンダクター(Fujitsu Semiconductor Limited); GenISys GmbH; GLOBALFOUNDRIES; Grenon Consulting; 日立ハイテクノロジーズ(Hitachi High-Technologies); ホロン株式会社 (HOLON CO., LTD.); HOYA 株式会社 (HOYA Corporation); imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; 日本電子 (JEOL); KIOXIA ; KLA; Maglen; Mentor, a Siemens Business; Micron Technology ; Multibeam Corporation; 日本コントロールシステム(NCS); ニューフレアテクノロジー (NuFlare Technology); Petersen Advanced Lithography; Photronics; Sage Design Automation; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC) ; STMicroelectronics; Synopsys; tau-Metrix; Tela Innovations; 東京エレクトロン (TEL) ; TOOL 株式会社 (TOOL Corporation); 凸版印刷 (Toppan Printing); UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx 及び ZEISS.

電子産業界に属する会社・機関であればどなたでもイービームイニシャチブの会員にお成りいただけます。詳しくは www.ebeam.org をご覧下さい。

本件へのお問い合わせ:

報道関係の方のお問い合わせは

オープン スカイ コミュニケーションズ (Open Sky Communications)

デイヴィッド モレノ (David Moreno)

電話: +1-415-519-3915 (米国)

電子メール: dmoreno@openskypr.com

まで英語にて、また

報道関係以外の方のお問い合わせは、

株式会社 D2S (事務局)

田中 喜男

電話: 045-479-8390

電子メール: ytanaka@design2silicon.com

までお願いします。

###